Title of the Invention: Liquid crystal display device

Laid-open Number: 56-57084

Publication date: 1981-05-19

Inventor: Yukitoshi OHKUBO

Applicant: Canon Inc.

Application Number: 133407/1979

Application date: 1979-10-16

#### Claims:

- 1. A liquid crystal display device comprising a reflection type liquid crystal display cell composed of a liquid crystal layer between an transparent electrode and a reflective electrode, and a light scattering layer or plate and a polarizing layer or plate which are provided on the transparent electrode side of said cell.
- 2. The liquid crystal display cell according to Claim 1, wherein a light scattering layer or plate is laminated on the transparent electrode, and a polarizing layer or plate is laminated on said light scattering layer or plate.
- 3. The liquid crystal display cell according to Claim 1, wherein said liquid crystal layer composed of a liquid crystal composition containing a dichromatic dyestuff.

### 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## @ 公開特許公報(A)

昭56-57084

**⊕Int.** Cl.<sup>3</sup> G 09 F 9/00 G 02 F 1/133 識別記号

庁内整理番号 7129-5 C 7348…2H @公開 昭和56年(1981)5月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

#### ◎液晶表示装置

创特

Ø#;

顧 昭54 133407

願

昭54(1979)10月16日

79発 明 者 大久保幸俊

東京都大田区下丸子3 丁目30番

2号キヤノン株式会社内

砂出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 5

砂代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 紅 雪

- 1. 発明の名称 療品表示装置
- 2. 等許請求の範囲
  - 1 対向した選光性の電振と反射性電極との間 に推品層を有して成る反射も放品表示セルと、 このセルの透光性の電振器に配設される光気 散層度は先拡散板と個光層或は傷光板と手具 傾して成るととを特像とする最高表示容置。
  - 2. 前記逃光性の電傷を募集にして傷光層東は 備光板、その上に、先拡散階級は光拡散板の 層に、夫々を重要した特許請求の範囲法 1 項 記載の液晶表示装置。
  - 3 前記鉄品層が、丁色性色素を含有した業品 組成物から成る特許請求の範囲無 1 項記載の 板品表示装置。
- 3. 発明の詳離な説明

本発用は反射型液晶表示セルを有する表示装置、とりわけ前配表示セル扩射ける表示欠陥を 電影した新規構成の液晶度示 (本) に関する。 液晶表示装置は、一般に、

- (i) 受験限(パッシブ)デオスプレイで、消費 電力が振めて小さいとと
- (2) 仮電圧で駆動できること
- (3) ボネル型の菓子にできるとと
- (4) 大型表示も可能なこと

2

-411£

を集めている。

斯かる会様に開示された表示装置では、第1回に示すように、基板B上ピグート線  $G_1$ ,  $G_2$  で、更にとれらの上の全面にわたつて熱療 層 I 、半導体8℃を積積している。又、ゲート機  $G_1$ ,  $G_2$ に交差して、半導体8℃に要するフース線  $G_2$ のいます。 のように対象に、アート級とフース線の変点付近には、セプテント電極となるドレイン  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ ,  $G_4$ ,  $G_4$ ,  $G_4$ ,  $G_5$ ,  $G_6$ ,  $G_6$ ,  $G_7$ ,  $G_8$ ,

上記半導体は解膜状的形成され、TFT (Ther Film Transistor) で代表される様々駅動用スイク チング裏子となつでいる。

1 記載前月スインドング案子アいてを有する 活破と、対向電観(例えば全面電優」を設けた 対向差板との間に根品層を挟持することにより、 第2区の等価回路が形成される。

 $F = F_{m{g}}(G_{ij},G_{ij})$  、 然な劇物電流が、 1 = K  $\#(S_1)$  、  $S_1$  …他は信号が印向され、 見つこれられなり、 ては、 それぞれ適当を行案事件  $(B_i + B_{ij})$  、  $F_{m{k}}$  、  $F_{m{k}}$ 

貴が行うわれる。

义、 $T_{m}$ 、 $T_{m}$ 、 $T_{m}$ ,  $T_{m}$ , m は、上途の様化して構成されるTFT、 $C_{m}$ ,  $C_{m}$ ,  $C_{m}$ ,  $C_{m}$ ,  $C_{m}$ ,  $C_{m}$ , m とないない。 上事とそれ自身のドンインとの間に形成される書間用ロンデンサー、 $\{C_{m}\}$ ,  $\{C_{m}\}$ 

一方、上記と類似の表示せんとして「EEE
Trans. on Electron Devices BD~20、P995
(1973) 内部示されている様々表示せかもある。このセルに受けるセンメントの一部の平面 図を銀3 時に示す。

即ち、複数のデート線 Ui、Gi、Gi、がガラス等の基板上に設けられ、この工に絶縁艦(不図示)を介して、半導体 S C を設ける。数半導体 S C の一端にはソース線 Si、t 体験には表示用セグメントのドレイン Diが景触して設けられる。数ドレイン Diの 下面には、半導体 S C が設けられて

いんだ。ト級 G, 化対し密接するが、上級 G, 化港 通した電極 P が対向している。この構成の等値 関係を集 4 図化示す。この第 4 図化がて、广選 と図と何様に)T, 技無 3 図で示す T F T、 L C, は、 ドレイン D, とアースされた対向電極(不図示・ 上の間に形成される液晶層を含むコンディサー、 C,はT P T のドレインと、数ドレイン 区対 モナ る ベート級 (G) に関係するゲート級 (G,) に導通 した電極 P との間に形成される著種用コンデン サーである。

上記の様な回路では、信号が選択されたデート製作印加された瞬間に 一大製の電圧がインインに加わり表示がまされる。その立ち上がりの時定数は、半導体のアン(ON)抵抗と容量液基層を含むコンデンサー及び警費コンデンサーの和)との機で決定される。

しかしながら、上記いずれの表示センドも、 無機されるべき問題が存在している。例えば第 上図の表がコルでは、半導体SCや基度日上の ほよ会面を覆りようにを成されているので、こ の半導体SOが不満明性部材で構成される特遇 過載表示セルが構成できない。ととで用いられ る半海体80の多くは不透明物質であるから。 反射型構造にして使用することになる。又これ 等に使用される半導体5日の多くが光導電性を 示し、その意味でも周囲先や用羽によつて表示 を見る根基セルでは動作の安定化の為、光難酸効 果の電極で、しかも根晶の光学的変化を効果的 化観察させる為、反射性部状が使用されること になる。そとで、 $D_1$  ,  $D_2$  ,  $D_3$  .  $D_4$  は金属電係と なり、適常では、セルの厚さを一定に保持する 意味からも鬱血反射を有するものとなる・鏡面 反射を効果的に光学的変化として捉えるために 社資来、動的散乱(DSM)モードが用いられ てきた。しかし鉄道桿産であるため、採允や際 用の内の外光や甍、窗具、観察者の顔等の鏡像 が表示面に形成され、表示効果を妨げる。これ を避けるため斜め方向からのみ襲察し、正反射 方がに略色のフードを渡したものが一部実用化 された。しかし、この表示方式は、比較的表示

重視の小さい数字表示では用いられるが、 整掛 テレビのような広い面積での表示においては正 **血から見る方が自然であり、しかも、見易いの** で、好ましくない。またDSMは比較的動作電 圧が易いこと、及び動作寿命が他の電界効果型 モード化比較して短いこと、色表示が難しい等 の生みも有している。とのね、とのようを映面 電衝構造のセルば他のモートを用いることが増 えられる。しかしながらTNモー くやかストホ ストモードを用いた時でも最高電極構造の生点 は増長されることはあつても畝じることはでき ない との欠点を解象すら産株で、特開報54 /學的定 ・27697 公報では背面の碁板を図凸加工し、 光散乱性の反射電極として形成する方法が提案 されている。したし、この構造はTFT構造の 断顧や、時性のバラバキを誘発すると同時に散 品モン厚の不均一性も年に、実用上問題が多い。

り、深さ図によって示される構造の表示セルではDiの表示厳肃電極を金属のようを反射性 材料を用いる場合は前端と同じ鏡像反射の化点

を考している。しかしこの構造は、半導体80 部に嵌するドレイン電極 Di として一部不透明部 奈に接するが、碁版や下地となる絶縁を交はコ とデビサーの対量等が透明部材からならことが 動作と可能である。従つて、TFT化った機構 表示センでは半導体部分を除いた表示部が、。 性の基板で共産済制御材のみによって構成され る構造が消走られる。とのようなセルでは、云 ∞の裏面に拡散反射 仮等を設けて反射 規構造と すれば、通常等計や電卓で使用されているT N 構造のサルが容易に用いられる。しかしながら、 との構造も魅いかの欠点を有する。例をは半導 体80部仕長バ部のバターンに比較して止さい ちが表示効果にとつて良いので、糖果的では、 表示パタップに比較して数細なパターと加工を 要求される。又ドレイン電視力として選手電視 を用いる場合半導体 8 じどのオーミンクな整触 世 問題を生じるととがある。とれを避けるため 十導体デオーミンク製触能材/透明電極といつ 充構造を年いれば下程が増す欠点しなる。 かが

R

透明電販として知られている酸化・エジウムや 酸化粧の電像形成性広く用いられている形成方 法では400℃を超す高温な正程を有する。これ は形成した単導体を1に好ましくない熱的影響 を与えることになり、特にアモルフォスシリコ ンを半導体を0として用った時間は、このよう ま高型過程は、その特性を破壊する次点となる。 とのようにある例のよりな構成の生態であり、 た形成表示センでも多くの問題を有している。

本名明成と記の議点に無みてなされたものであり、他の企工機の組み、小の欠職の住り難い場合が正をよって作っれるエドエを有した機構表示技能を与えるとけた目的とするものである。 又本発展の東京目的は充分高いコントラストで広い視野角の設定効果を有するマトリップストで広いは大人を与えるとしてある。更に本発明のある目的に関連性表示のできる画像表示用バネッを与えるととである。

文、機業数の増加が対する要求、一齢其の小面積化的対する要求に適応し易い構成の表示が

ホルをおえることを目的とする。

この様々目的を達成する本稿事の厳品表り装置は対かした避光性の質疑と反射性健康と反射性健康との関係を表示して、このセルの透光性の電極別に配設される工物を構成は異なることを特徴とする。このように構成した改品表の基礎は最も作り甚ら下上すと構成の厳格表の、メルでありながら高度の表示効果を得られる。

以下本集明を図面がよつて説明する。

10

による鏡面圏Mを形成したものか誰ましい。無 6 國は、第5 図の部分A - A' 化ねつた断面図に よるTFT化した基板を含む本発明の一実着例 の略断面外である。基板B上にストライプ状化 形成したゲート酸 G1 ( G2 , … ) があり、この上 **に絶無磨」が横層されている。この上に全面半** 再体層SOが形成されている。この半海体SC とオーミックな接触をする細いストライプ状の ノニス級 S, 、S, 、 がゲット 船を交差して配置。 され、プルス取る交流と「配機方力」 ソース機 停予機能  $S_{t+1}$   $S_{t+1}$  他近接して各ゲート書  $G_{t+1}(G_t)$  )上にドレイン電板  $D_1$  ,  $D_2$  , … が設けられている。 一方、三配のドレイン電極 $D_{i}$ 、 $D_{i}$  : に対向する 電傷差板として、例えば差板1の全面に透明導 電層 2 を形成した対向基板をスペーサ (不関示) を介して数け、これ等の間に二色性染料を含有 した液晶腫すを挟持してマトリンクス表示で厳 品)セルが構成される。旬、3位必要に応じて 設けられる絶縁層であり、TFTアレイを有す る茶板の側にも設けるととができる。更に疾病

c 服する面には被暴分子が電圧を印加したい時 の初期状態において整殊するための配向膜(不 図示)が適宜施される。又、基板Bの裏面には ドレイン電極 Dii, Dii と向一の反射 寒を示す鏡 面層Mが設けられている。以上に加えて、 f は 個先板で、5位光弦散層で、何れも(好ましく は)級品階(にできるだけ近夢して配置される。 従って、第6回示例と連つて優光板6が蒸板1 に重要された構成であつても良い。との様に構 皮した時の本発明の動作原理を示す。狭持され た液晶腫 4. の被基分子は電圧の印加時と非印加 時において二つの状態の変化がある。即ち、一 つは項品分子長軸が基板(4),1に対して垂直を 状態であり、他の一つは茎板に平行で河一方向 化差列する状態である。 そとで、 誇 電 異方性 が 正の産品では非印加時に平行で、印加時に垂直 であり、誘電異方性が負の複晶に対しては非印 加時に垂直で、印加時に平行な配列となるよう 初期の配列を行つておく。夢板B,1m対して 垂直状態に配向している仮晶分子がある時、と

の数晶中に含有した二色拌燥料・複晶の配向と協調して単度配向しており、光の教収が無いかれしくは少い。一方数晶とそれに動調する染料を平行状態とをつた時はモが破むされ、教収液後に応じた着色が観察される。最も効率的を教とで応じた対応の染料配向方向と偏光接もの偏光方向を一致させた時であり、このために、偏光方向をし、その偏光能が平行状態にある染料の分子軸と一致するように設けられている。

説明の便宜上、無」の説明に恐いては、先学的変化のONとOFFの二つの状態のみを連出したが、二色性発料を含有した根基層よか利用される系では、中間値の知識圧に対して、後の活動を対しても、というの名では確認変化量を示しようを意味している。この状態変化だけでも概察者のは変別をあった。しかしながらドレインを保力し、Di、Di、一及び裏面の鉄面層が対象の鉄像をあるので、しばしば見難いことが生じる、本発明ではこの鉄像を除去する目的で先級数量

5 が設けられている。この払散層 5 は 師像を除 去するがドレイン電極 Di 、De 、 によつて生じ **元光量液化は透通し得るもので、比較的光散乱** 性の難い光散風能力を有すれば良い。又好まし くは 仮品借 4 での光学的変化を明瞭に識別し易 くけるため、攻晶暦4代近接させることが必要 である。とれを具体化する一つの例が果7選に 示されている。とれは 教察者 () 側の 無根として 振めて痒い サラスをの一方に透明電極 2 、 絶象 署3を形成し、反対の面に偏向標 6 及び先型散 性部材5を積層して左ろものである。とのよう な構成とすることで、青いガラス板の変形を光 拯軟性能材 5 が防止し、しから6の 無光板が絶 機勝るに強する根晶層に近要できる効果をもた らす。更に果8回は薄いガラス板から成る基板 1の一方に7四と同様の電镀2を形成し、他の 例に偏光器もを設け、この上に光鉱散層する処 理した後、変形防止の部材でを推薦してなるも のである。光拡散層 5 立厚く、 又絶野 雇 3 側に 配した不過示の故島層から触れる化発つてマレ

13

11

#### 特際昭56~ 57084 (5)

イン電視上での光学的変化部はボケとをつてく るのをとのような構造で防止するととができる。 最も幽厳のポクは本務明による効果の1つで、 とればよつて絵楽間の分離が見掛け上勝和され る。しかし本発明による光磁散能は養俸を抵ね 除くためのものであり、(この意味からは出験 的弱い光拡散能を有すれば良いととを能述した がうとの意味では、個光酸 6 と光拡散催らの観 群者 0 側からの位置は交換しても、類似した表 示効果は得られる。しかし、光拡散能は偏光性 そ多少なりとも放じるので暫えてそのような配 置とする必要はない。但し、毎に允拡制層 5 を 夜品腫に近接したい時、そのような配置とする 場合も本発明は含むものできる。

本発明による本来の効果は、ドレイン電極が 袋面状態にあるTFTアレイを有するパネルの 表示効果を充分高めたものであるが、健由ドン イン電極構造を用い得る点でのCPTアレイ構 |塩は数々の利点を有する。

即ち、男5区、親6凶に凶示したとかり、性

15

導体8 0 上化2 ス線 81,82,…を除いた大阪 分の面に対して光分大きく素子絵葉となるペレ イン電影Di, Dr. · を形成できる。これは第3 図のような構成で遊過型セルを構成した時、半 再体SCの部分が黄子に寄与しない部分として 有効表示面を報じているととと比較して表示効 果上でプきな差がある。これは穀素電信を積極 化しようとする時時に重要で、第3回のトラン ジスチ構成部分が相対的に程度の 微細パターン か要用されてくる点と比較して容易に理解され よう、とれに対し本条明による範面構造を含む 表景では、半導体 S C のパターン化が不用であ り、イターン特度はノース線とドレイン電腦と のギャンプ精魔だけで良く、特性の均一化、信 験性の向上、生産工数の概念、コストの低下等 戸部 **に大きて寄与する。又とのような観節状ドレイ** ン電極は半導体SUに対しての光連軽効果を完 金にし、動作を安定化するとでも有利となる。 更にトレイン電板による鏡面反射によつて液晶 種4を称復する光は透過構造に比較して二色性

袋科花対 走る吸収を効率的にし透過型と等しい **吸収を得るためには2分の1の染料板加量で挤** み、又同農産にした場合はに倍の吸収効果があ げられる。更に推過型表示の場合は透判導電膜 を用いるので単導体とのオーニンク接触に対し 考慮を要するが、鉄面状金属膜から成るドンイ ン電板の場合はとのオーミソクを接触を生じる 材料として比較的広の範囲の材料が差択できる。

本発明の装費を構成する募板( 1<sub>2</sub> , 8 ) 化使 用される材料として、ガラスが一般的なもので あるが、反射構造であるためBとしては金属。 セラミックス勢不遵明を材料であつても良い。 再覧性材料、即ちが、上輪 G, 1人(G; …)、フース・ 華 S<sub>1</sub> , S<sub>2</sub> , … , ドレイン電框 D<sub>1</sub> , D<sub>7</sub> , … 対角電 ● 2 等には透明部は Tn₂O₂,Sr O₂の導電性週明 酸化物水、不透明常はA4,Ag,Pi,Pa,Cr、 Ni, Mi, Sr 等の金属文はその合金が用いら れ、中導体SCとのオーミンク安赦と襲回の場 合は反射率の点から異択される。絶異層3とし  $t \approx 810^\circ$  ,  $810_2$  ,  $T_1O_1$  ,  $Z_0O_1$  ,  $AZ_1O_2$  ,  $C_0O_2$  #

の全層酸化物。 MgFx ,CaF。 等のハロガン化物。 そう化シリコン、ガラス損等から適宜過ばれる。 薄膜半導体としては Grist , Cd Se , Se , Te の 他でモルファスSi 等が選択使用される。 疾品 物質は正の跨電具方性を示すか又は負の務電具 方性を示すネマティング物質が用いられる。 こ **おめ切えて、二色性染料として、アンメラギノ** ンネ契料、アゾ契料、メロンアニン聚料等を通 宜選択して用いる)

上述の構成とよって得られる後品表示装置は 生産性も良く、歩留まり、表示の見え、動作を 定性等の点で良好な結果を与える。又非常世見 裏の表示効果を与えると同時に、簡調性表現に も考している。更に、本発明に用いた光学的な 構成、角ち背面の反射電極、二色性染料、透明 電極のセル構成に対し、貨光板と光拡散板によ つて観察し得る構造に関しては、TFTアレイ を伴わないゲストセストモードの通常表示装置 においても有効で本発明の範囲にある。

水発明の表示装置は、高密度のセグメントを

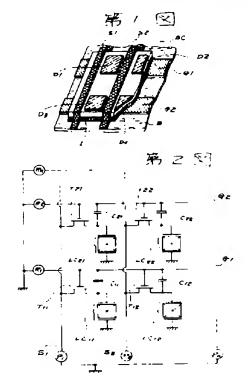
18

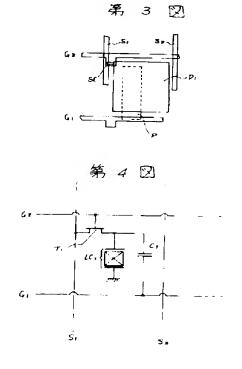
有する表示装置、 毎に実像表示を行なうテンビ、 ビデォカノラ用モニター等の表示装置に好達に 使用される。

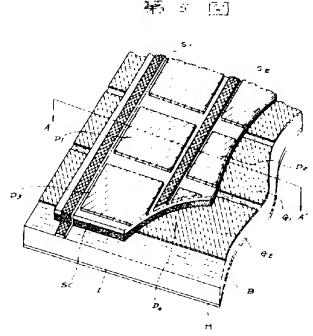
## 4 図面の簡単な説明

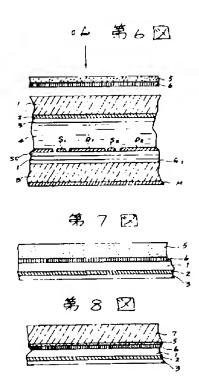
第1 図及び思3 的は夫々、従来失敗に於ける T F T アンイ構造を説明する説明図、原2 的は 第1 図に対応する等価回路図、第4 的は第3 図 に対応する等価回路図、第5 的は本発明の一実 施例に於けるT F T 配 取基 板の再変例を説明する る部分拡大針視図、第5 図は本発明の一実態例 を示す略画断面図、第7 図及び第8 図は夫々、 本発明の変形例を説明する為の部分的略画断面 図である。

> 修許出顧2. キャノン株式会社 代 理 2. 丸 島 鉄 一部設 オ オ 19









# 特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 54 年特許順第 133407 号(特開昭 56- 57084 号 昭和 56 年 5 月 19 日 発行 公開特許公報 56~ 571 号掲載)につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 6(2)

Int.	. ' .	推别配号	厅内整理者	ij
G 0 9 F	9/00		6 / 3 1 - 5 C	
G 0 2 F	1 / 1 3 3	!	7 3 4 6 - 2 H	
		l i		
		1		
		1		
		i		

手統補正書(自発)

н ю 59 ≈ 7 я 19 в

特許庁長官 若 杉 和 央

1. 事件の表示



**昭和54年 南井**編 # 1334D7

2. 発明の名称

报品表示装置

3 補正をする者

事件との関係

任 师 重京部大川区下五子3-30-2

名 券 (100) キャノン株式会社

化鱼类質 来 龍 三 郎

4. 代 理 人

居 所 图146 麻麻斯大组区下丸子 3 3 2

氏名 (5987) 井田士 丸 島 儀

5. 補正の対象

6. 補正の内容

(1) 図面の第2回を鉛紙森付の図面のとおり訂正 する。

# 第2回

